

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor 推出新型缺陷發現與監控技術

*NanoPoint™ 利用關鍵圖案實現*

*快速實用的設計檢驗和高度靈敏的製程監控*

【加州 MILPITAS 2013 年 4 月 23 日訊】今天，[KLA-Tencor 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）宣佈為其 2900 系列檢測缺陷系統推出一套新的專利技術 — NanoPoint™。NanoPoint 能夠以光學速度，在現有光學檢測缺陷系統上，採用一種全新方法去發現和監控缺陷。NanoPoint 已經在初期金屬層上顯現價值，克服了以前曾經局限先進節點的生產線上對細微的良率致命缺陷進行檢測的能力，例如在密集圖案上線邊緣粗糙度 (LER) 的檢測的能力。

KLA-Tencor 公司副總裁兼晶圓檢測 (WIN) 事業群的總經理 Keith Wells 表示：「我們的客戶熱切期望繼續推進 20 奈米以下節點的光學線上缺陷檢測。他們想要只有光學檢測才能提供的速度和基線保持 — 同時，我們面臨的挑戰則是要設計出能夠發現線度越來越小於檢測波長的缺陷的設備。我們過去曾針對光源、光學元件及其他子系統提出過各種改進方案，但 NanoPoint 則是從一個新的角度解決問題。根據客戶回饋，我相信 NanoPoint 是一項突破性技術，在多樣的層和製程模組上均具有應用潛力。」

NanoPoint 將光學檢測系統的資源集中于電路設計師已知缺陷部位所確定的關鍵圖案。在晶片開發階段，NanoPoint 能夠在數小時內揭曉是否需要重新設計掩膜，從而大大加快設計問題的確認與解決速度，能從數月之久縮短至數日之內。在大批量產階段，NanoPoint 能夠專門追蹤關鍵圖案內的缺陷狀況 — 令製程監控的靈敏度和速度遠遠超越業界迄今為止所能達到的水準。

NanoPoint 技術擁有若干新型專利支持，是 KLA-Tencor 公司在其晶圓檢測部及 KT 實驗室（技術長 Ben Tsai 博士領導下的研究機構）內歷經長期研發努力而形成的產品。北美、歐洲和亞洲的主要邏輯電路、晶圓代工及記憶體晶片製造商已經安裝了多套 NanoPoint 系統。若要瞭解關於 NanoPoint 技術的更多資訊，請瀏覽 KLA-Tencor 的 [2900 系列產品網頁](#)。

**關於 KLA-Tencor：**

KLA-Tencor 公司是製程控管與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關的奈米電子產業提

供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

**前瞻性聲明：**

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 NanoPoint 技術或 2900 系列缺陷檢測系統的預期效能、半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 NanoPoint 技術或 2900 系列產品的預期使用，以及 NanoPoint 技術或 2900 系列產品使用者可以實現的預期成本、營運及其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###